

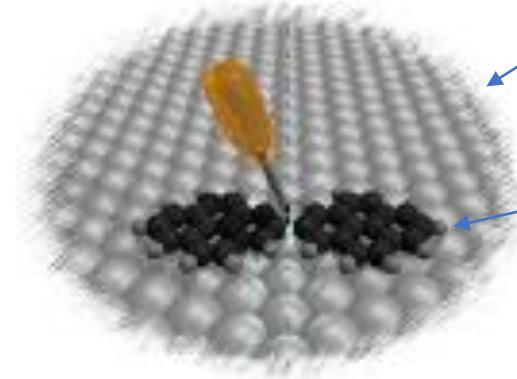


Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Doktorski studij kemije

Kontrola kemijskih reakcija na površinama

Kemijski seminar I

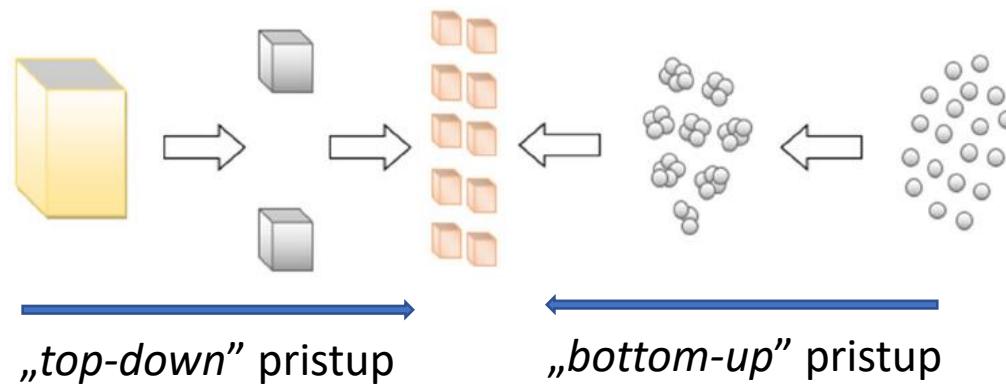
Nataša Burić



Supstrat – površina na kojoj se odvija reakcija
- metali (najčešće Au, Ag, Cu, potom Co, Pt, Pd)
- grafit (HOPG, *highly ordered pyrolytic graphite*)

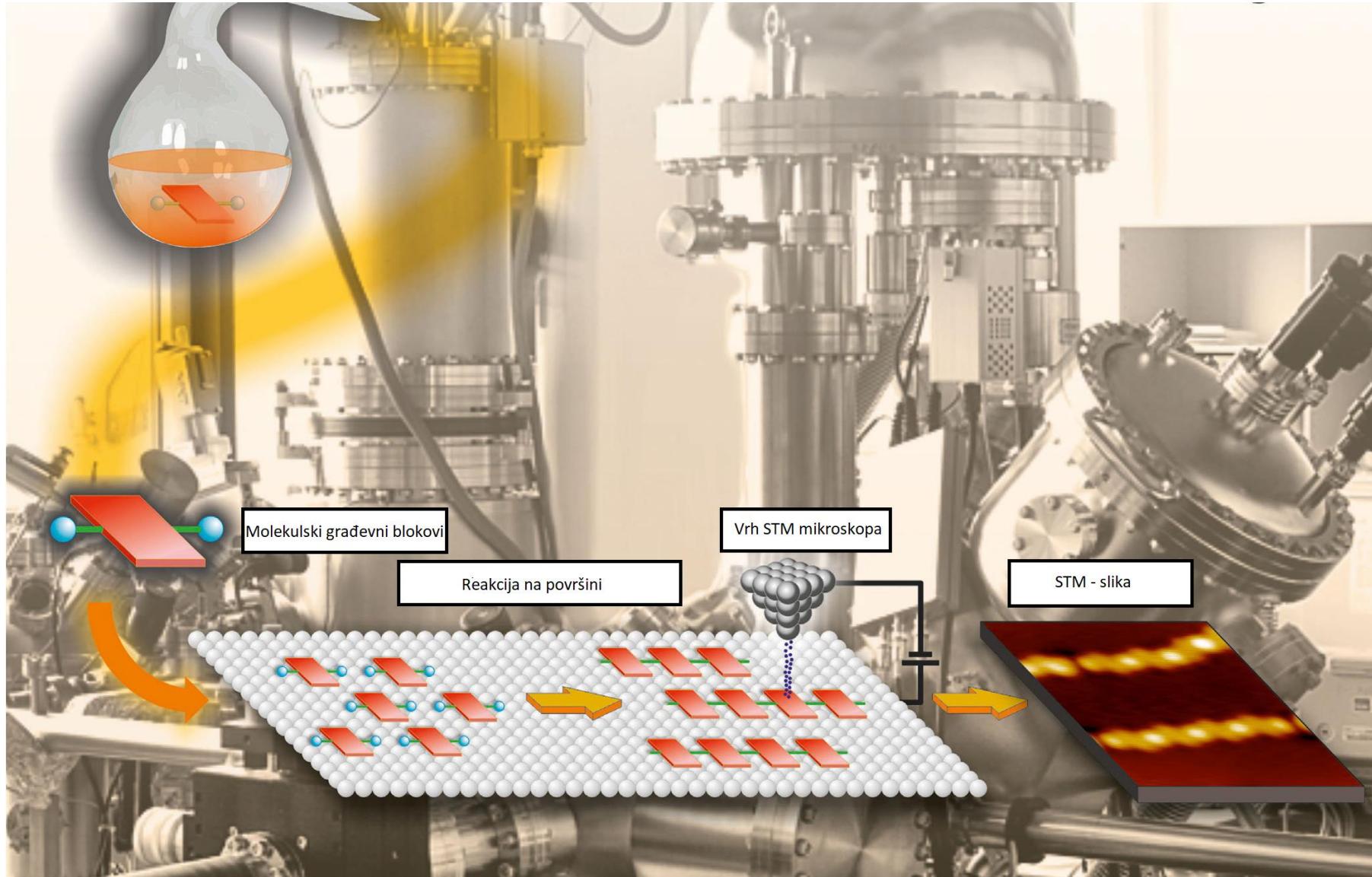
Prekursori – molekulske građevne jedinice

Uvjjeti ultravisokog vakuuma (UHV, *Ultra High Vacuum*)



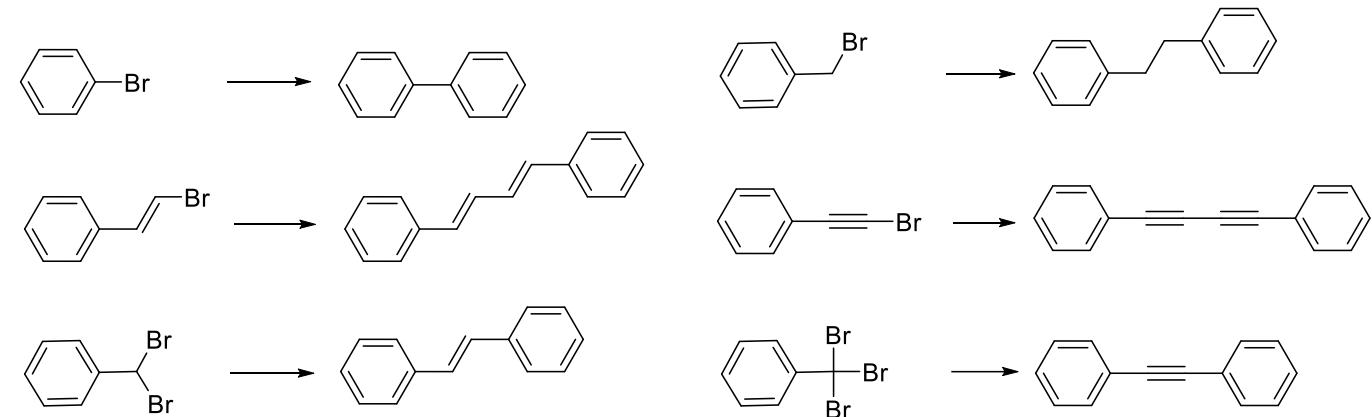
„Top-down“ pristup
– organske reakcije u otopinama

„Bottom-up“ pristup
– u nanotehnologiji
– priprava uređenih nanostruktura počevši od pojedinačnih molekula kao građevnih jedinica

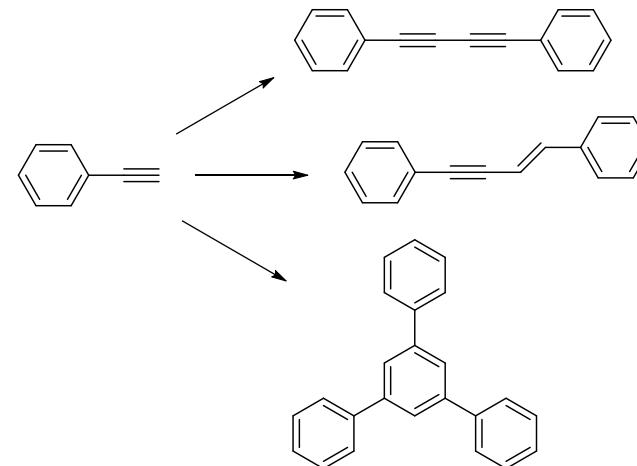


Reakcije na površinama koje imaju dobru ponovljivost:

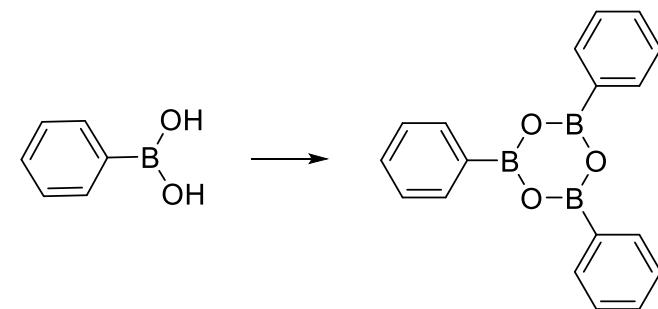
1. Ullmannova kondenzacija



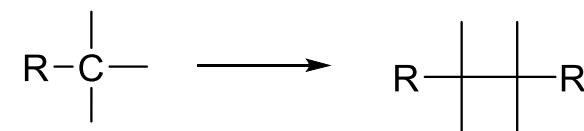
2. Glaserova kondenzacija



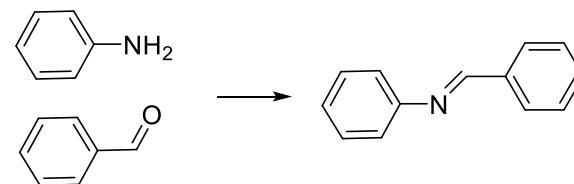
3. Kondenzacija derivata borne kiseline



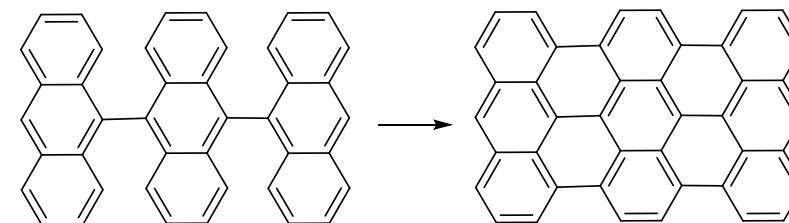
4. Direktna C–H aktivacija



5. Kondenzacija aldehida i amina



6. Intramolekulska kondenzacija



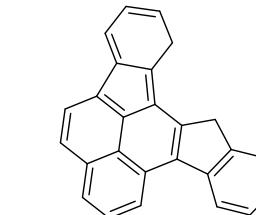
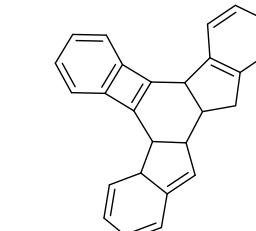
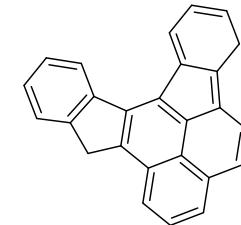
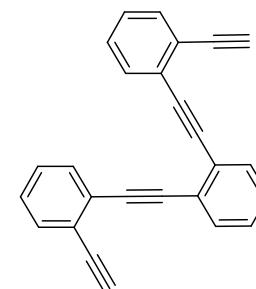
Najvažnija je pretražna mikroskopija:

- **Pretražna mikroskopija s tuneliranjem (STM, Scanning Tunneling Microscopy)**

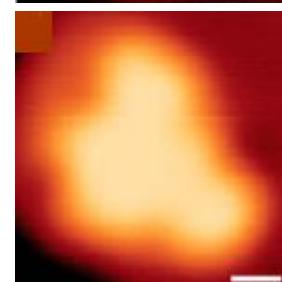
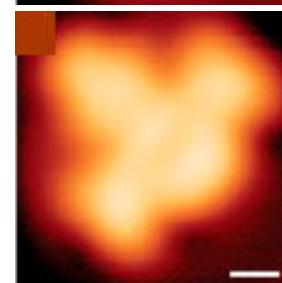
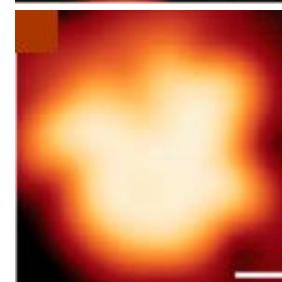
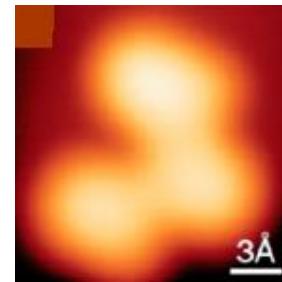
- vrh od vodljivog materijala (meta ili ugljikove nanocijevi) pomoću kojeg se pretražuje površina
- Nobelova nagrada za fiziku 1986. godine (Gerd Binnig i Heinrich Rohre)

- **Mikroskopija atomskih sila (AFM, Atomic Force Microscopy)**

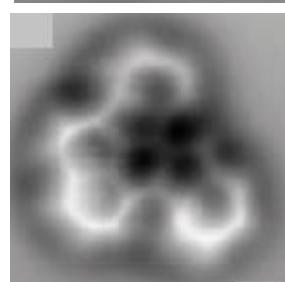
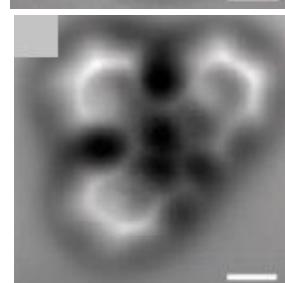
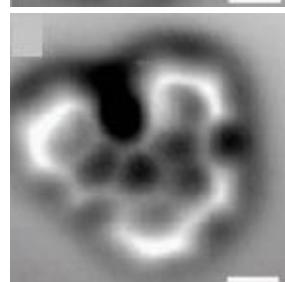
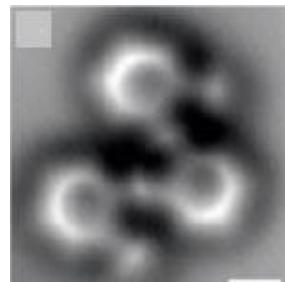
- vrlo visoka rezolucija
- omogućuje vizualizaciju na atomskoj razini

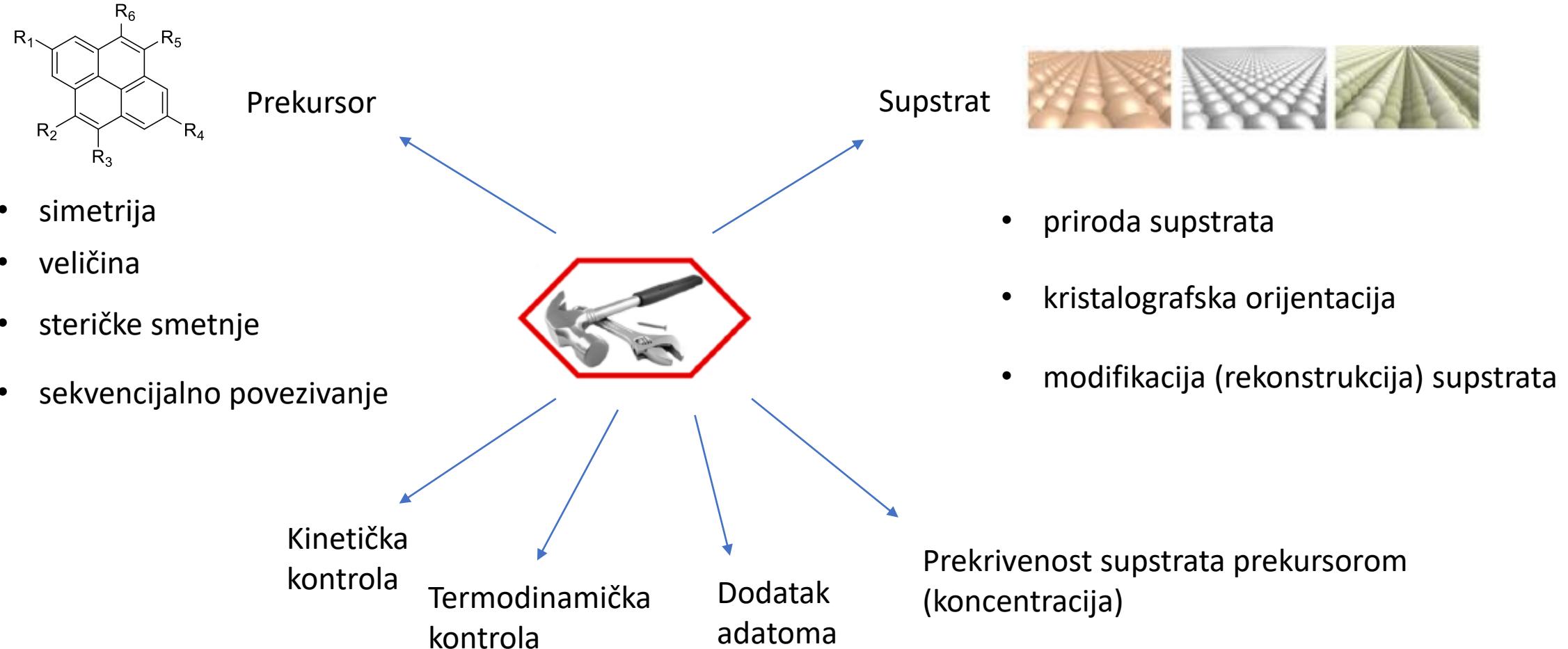


STM snimke

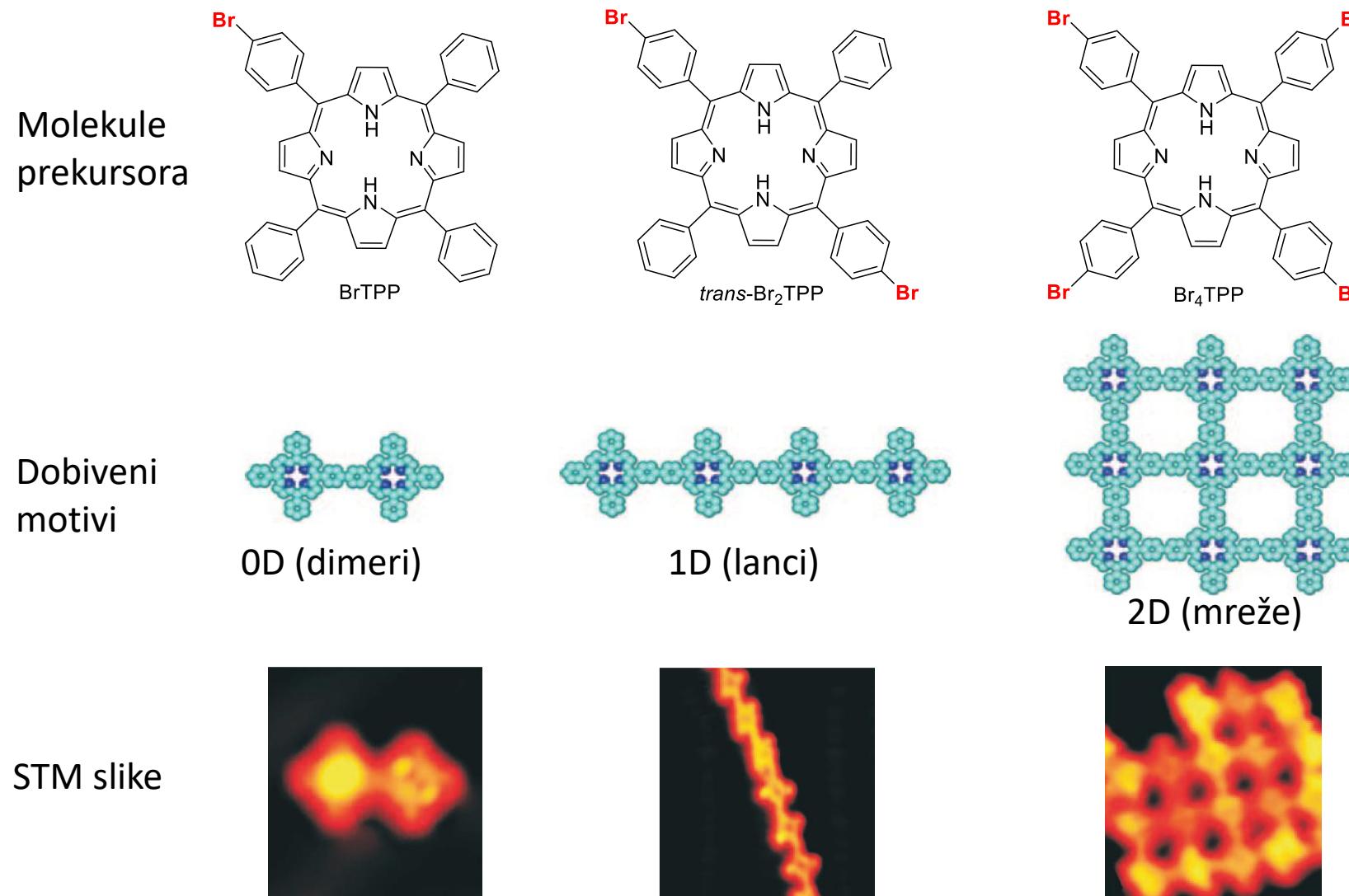


AFM snimke



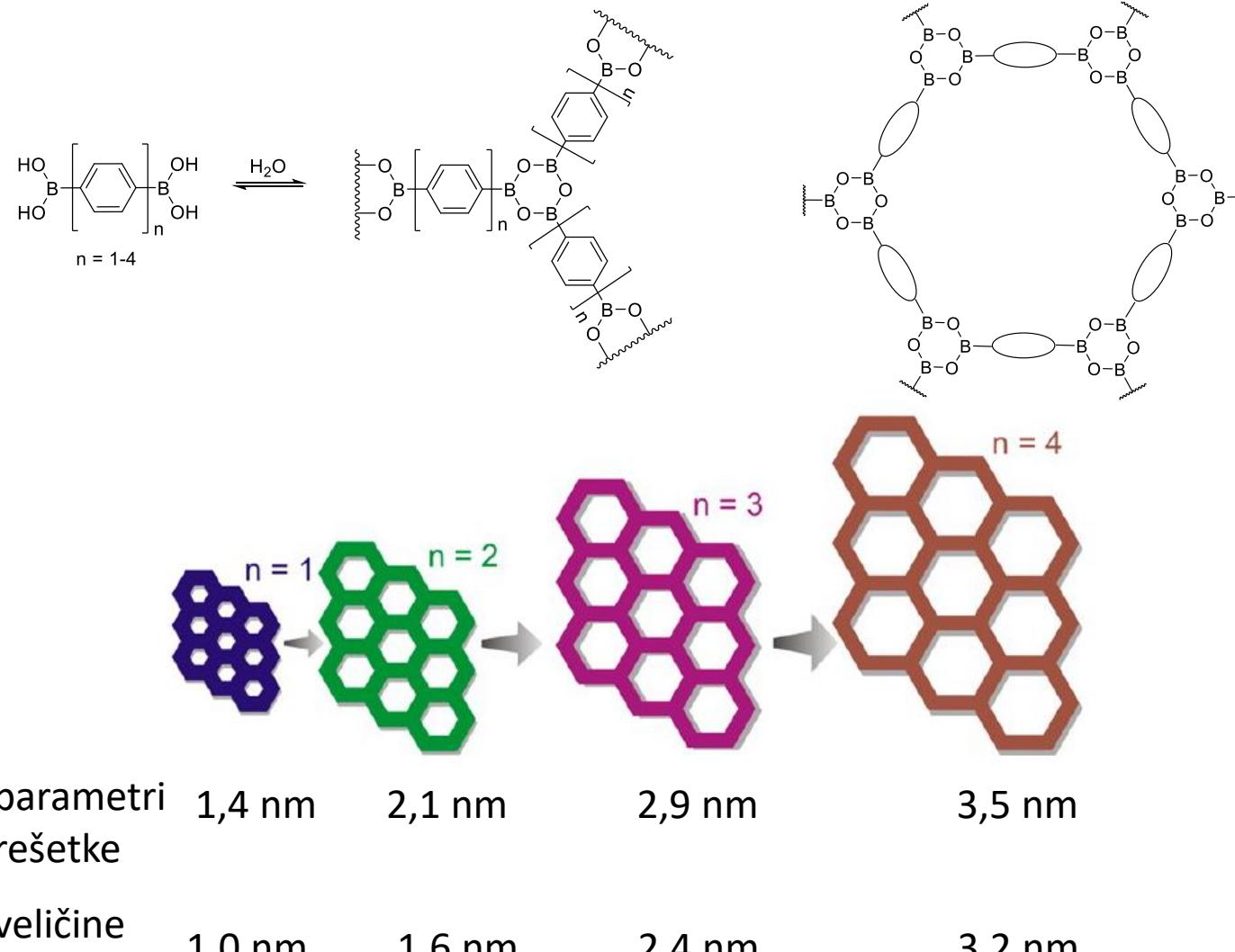


Simetrija prekursora



- Eksperiment je proveden na Au(111) supstratu
- Obzirom na broj reaktivnih mesta dobiveni različiti kovalentni motivi
- Uređenje strukture dobivene deponiranjem prekursora na supstrat, a tek potom termičkom aktivacijom
- Smanjena mobilnost i difuzija već spojenih prekursora dobivenih aktivacijom prije nanošenja na supstrat

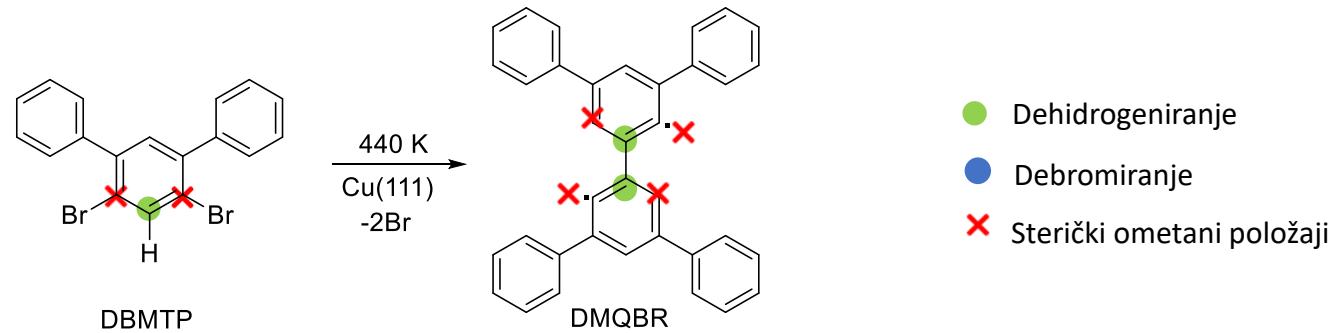
Veličina prekursora



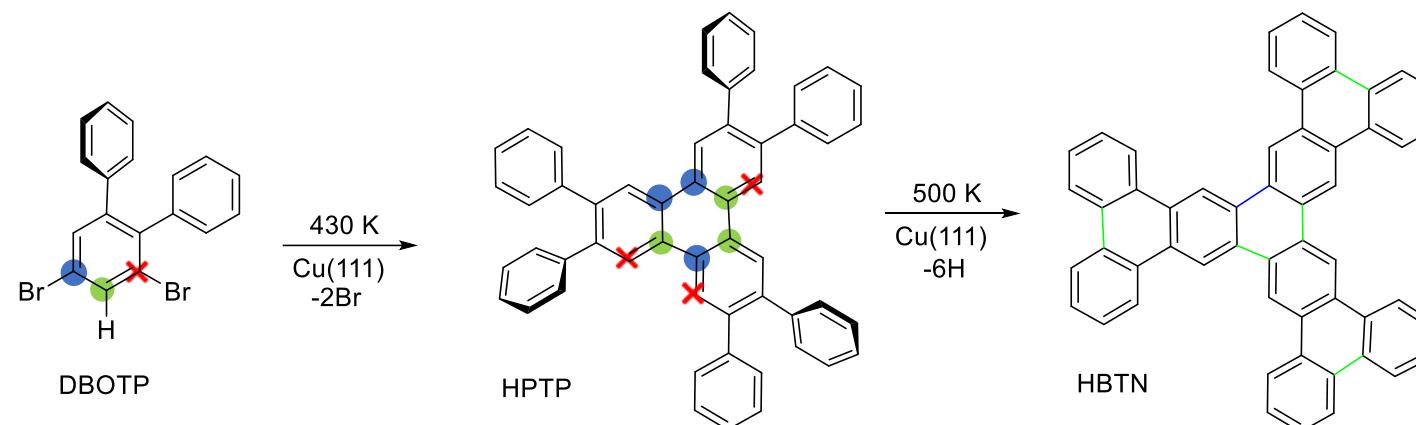
- Supstrat – grafit (HOPG)
- Prekursori – derivati 1,4-benzendiborne kiseline koji se razlikuju po broju fenilnih jedinica ($n = 1-4$); jednaka simetrija
- Reverzibilni uvjeti
- Dobivene heksagonalne strukture različitih veličina pora
- $n = 3$ – najuređenija 2D mreža
- $n = 4$ – manja uređenost (slabija pokretljivost većeg prekursora)
- $n = 1$ i 2 – nisu zamijećene stabilne uređene mreže (slaba interakcija sa supstratom)

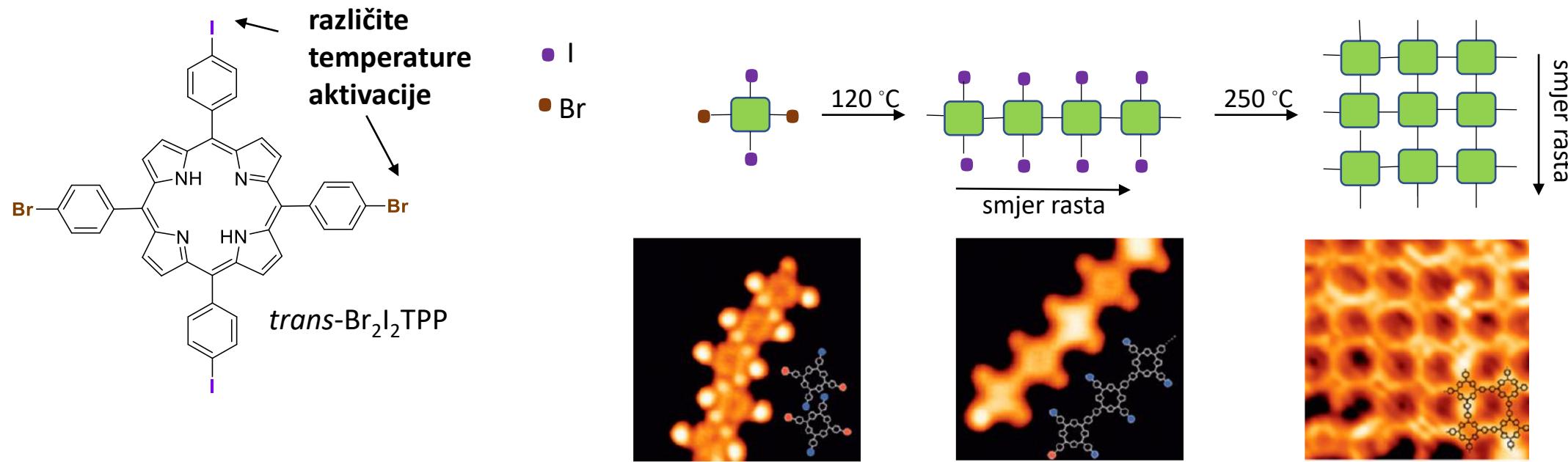
Sterički faktori

- Supstrat – Cu(111)
- Prekursori – DBMTP i DBOTP



- DBMTP prekursor
 - sterički blokirano Ullmannovo povezivanje na C–Br pozicijama
 - reakcija usmjerenja prema C–C povezivanju
- DBOTP prekursor – samo jedan C–Br položaj sterički ometan
 - Ullmannovo i C–C povezivanje
 - nastajanje planarnih struktura na višoj temperaturi

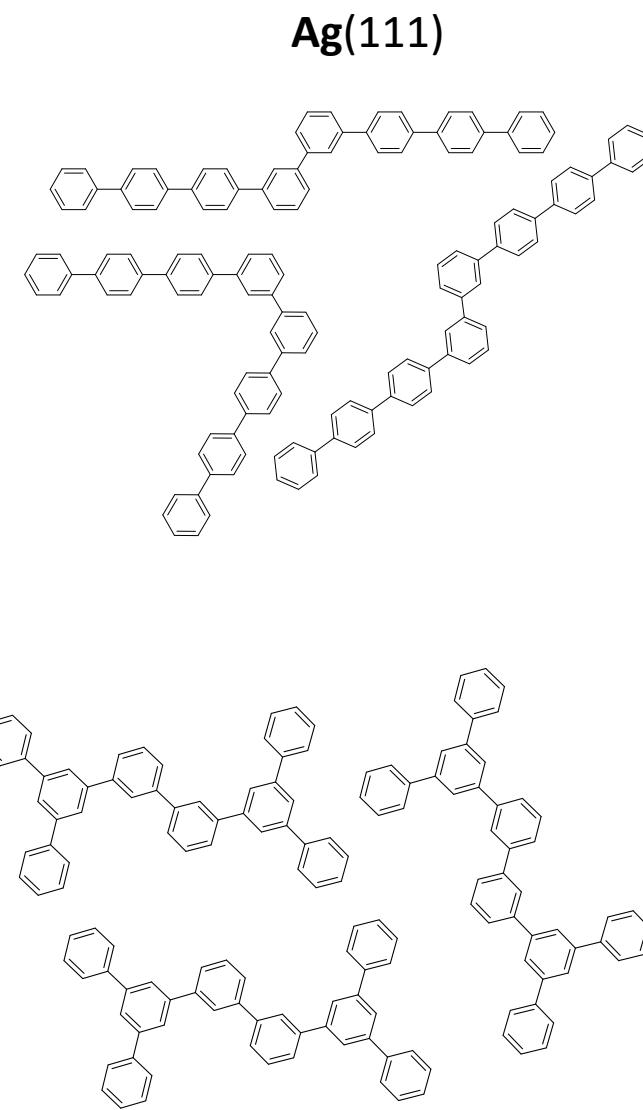
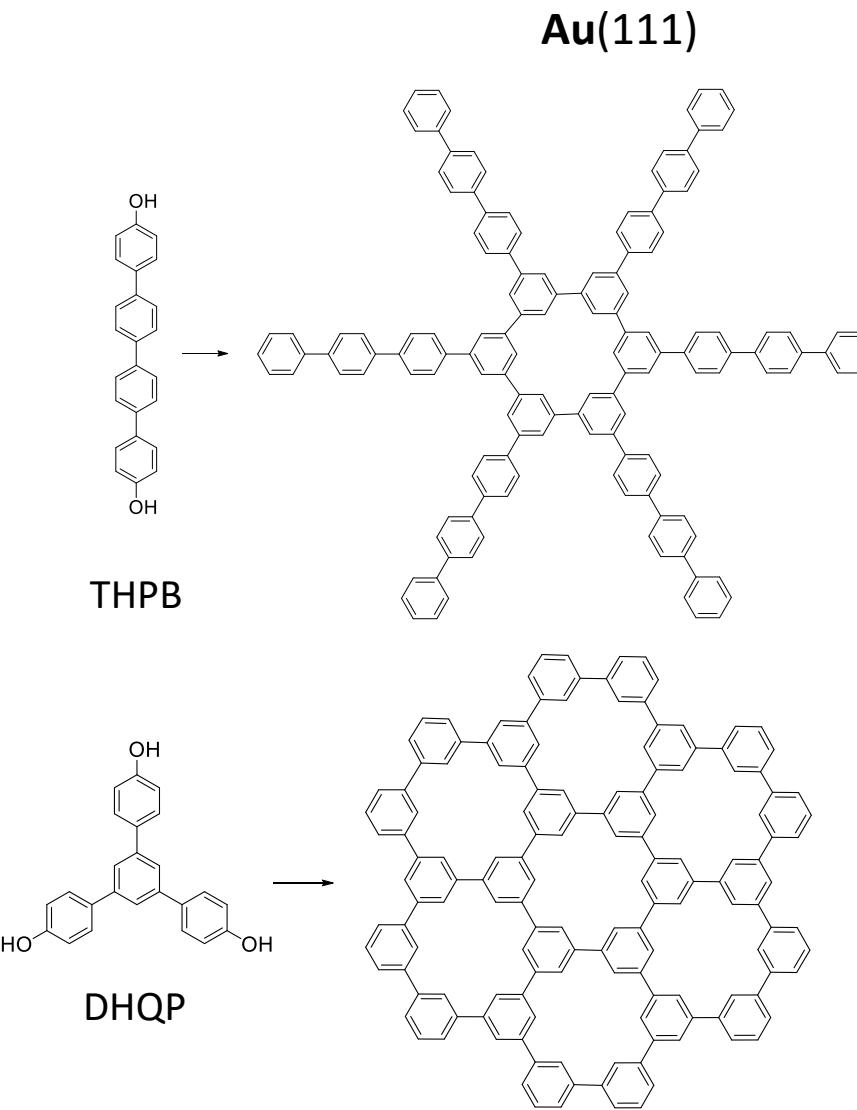




- Supstrat – Au(111)
- Prekursor – *trans*-Br₂I₂TPP

- Selektivna aktivacija uslijed različitih disociacijskih energija Br–Ph (366 kJ/mol) i I–Ph (272 kJ/mol) veza

- Uređenja struktura nego korištenjem Br₄TPP prekursora u istim uvjetima

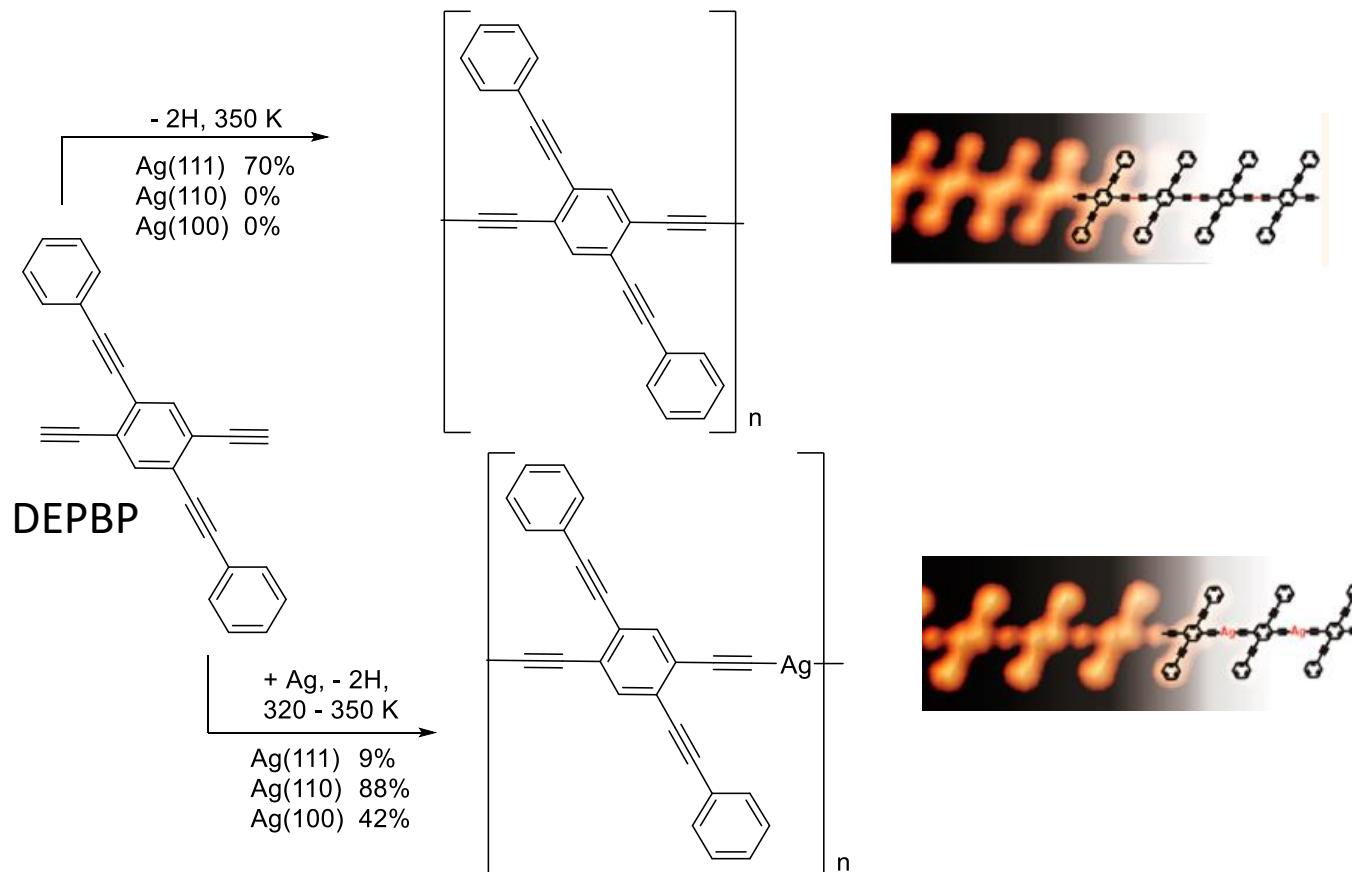


Različiti supstrati jednake orientacije

- **Au(111)** supstrat – aktivira obje *ortho* C–H veze obzirom na OH skupinu
 - energija reduktivnog deoksigeniranja viša od energije drugog dehidrogeniranja
- **Ag(111)** supstrat – aktivira samo jednu *ortho* C–H vezu
 - energija reduktivnog deoksigeniranja niža od energije drugog dehidrogeniranja

Različito orijentirani Ag supstrati

- **(111)** – heksagonalni; najinertniji
- **(100)** – kvadratni
- **(110)** – pravokutni; najreaktivniji



Prekursor – 2,5-dietinil-1,4-bis(feniletinil)-benzen
DEPBP

- $\text{Ag}(111)$ – katalizira povezivanje terminalnih alkina (Glaserova reakcija)

- $\text{Ag}(110)$ – selektivno nastajanje 1D srebro-acetilidnih lanaca
 - površinska rešetka supstrata odgovara periodičnosti organometalnih lanaca
 - termodinamički stabilan produkt

➤ Kemosorpcija prekursora na specifična mjesta supstrata → epitaksijalni rast

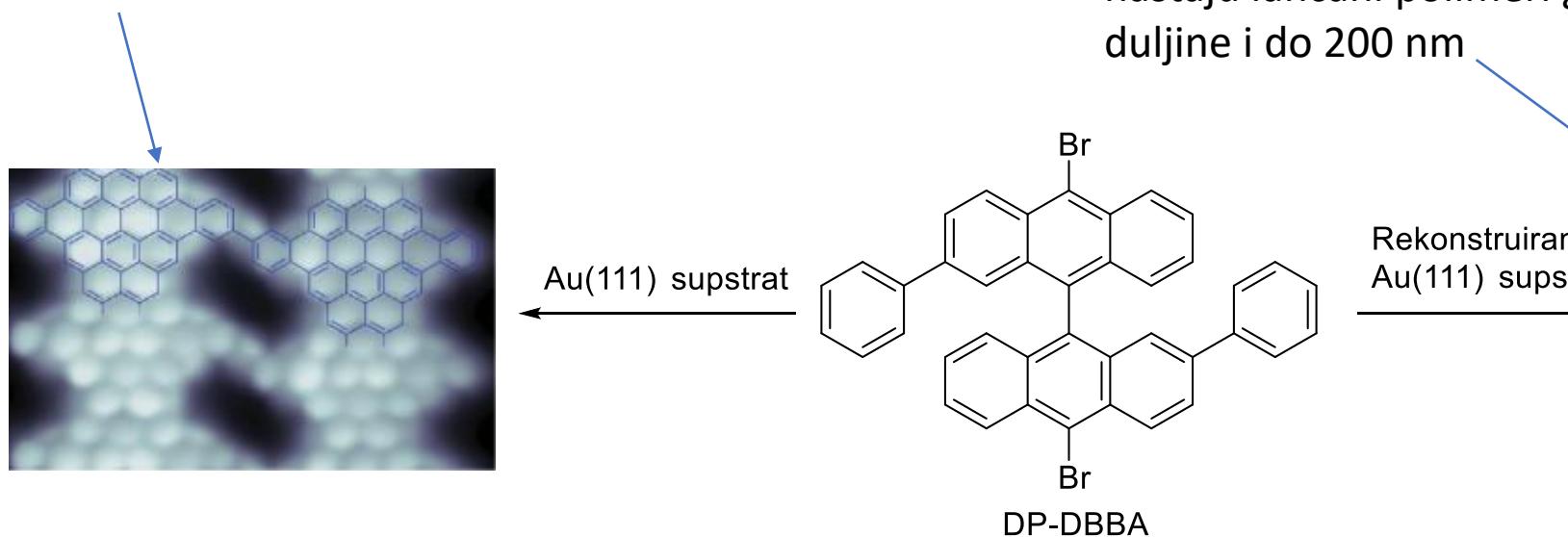
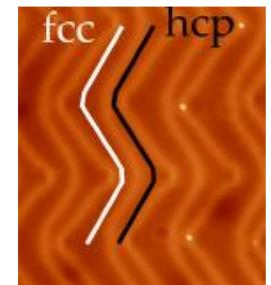
Prekursor – DP-DBBA

- **Au(111) substrat**

- Ullmannova kondenzacija, potom
- ciklodehidrogeniranje i
- dehidrogenirajuće unakrsno povezivanje
- nastaje nanoporzni grafen

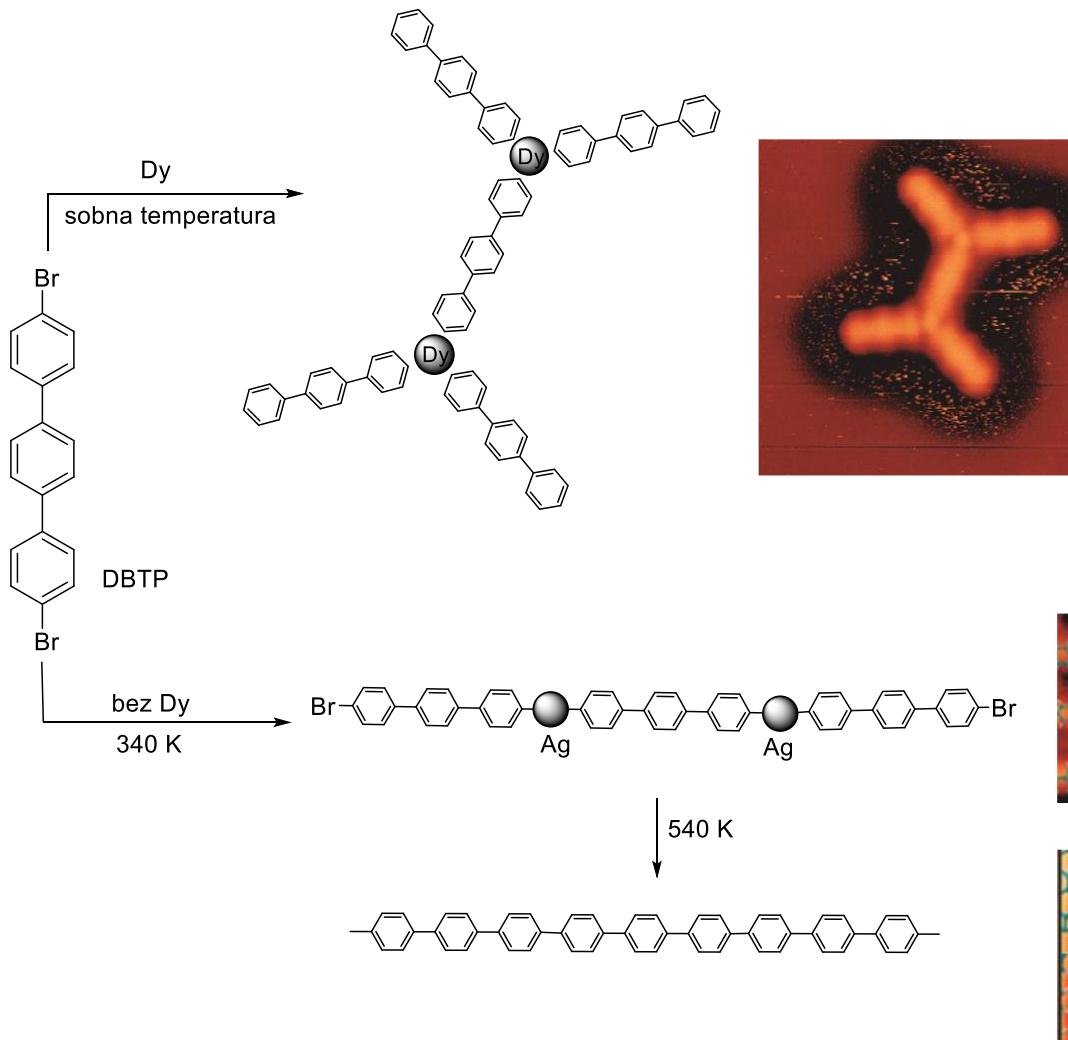
- **Rekonstruirani Au(111) substrat**

- plošno centrirana kubična rešetka izmjenjuje se s gusto pakiranom heksagonalnom rešetkom („zig-zag“ struktura)
- Ullmannova kondenzacija
- nastaju lančani polimeri grafena duljine i do 200 nm



Dodatak adatoma

Adatom – dodatni atom adsorbiran na supstrat



Supstrat – Ag(111)

Prekursor – DBTP

Dodatak Dy atoma:

- katalizira debromiranje DBTP prekursora na sobnoj temperaturi
- nastaje TP–Dy–TP supramolekulska struktura
- inhibira C–C povezivanje

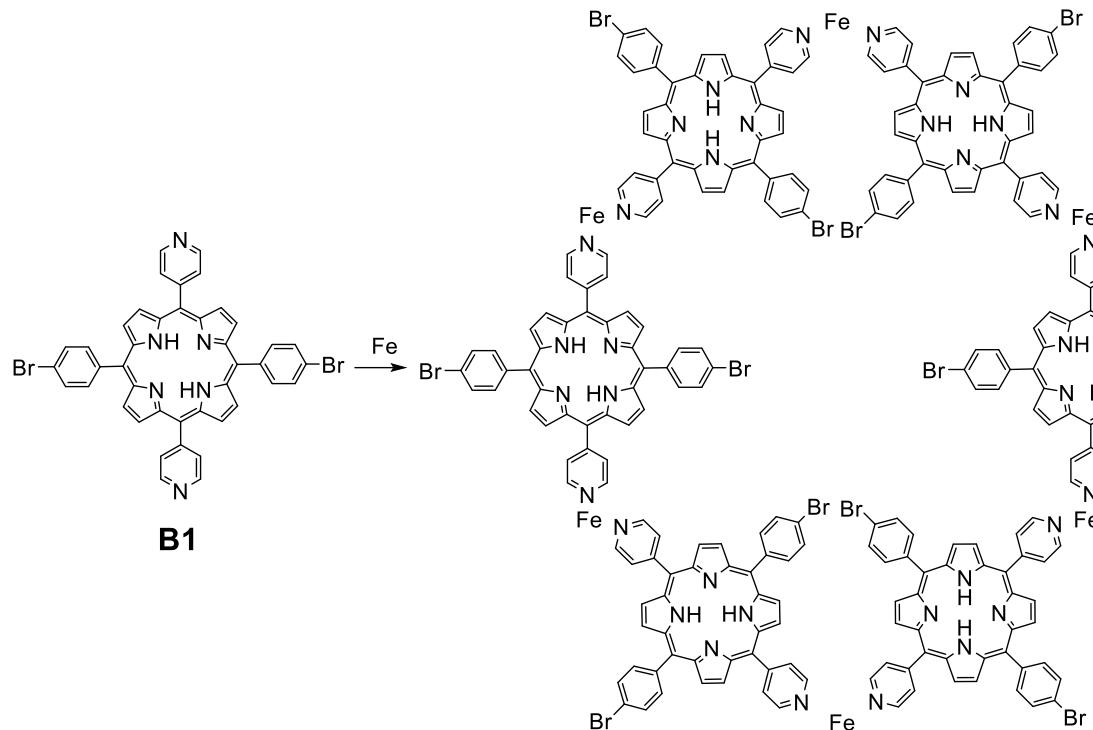
Bez dodatka Dy atoma:

- do potpunog debromiranja dolazi na povišenoj temp. (340 K)
- na 540 K dolazi do nastajanja C–C polimera

Dodatak adatoma

Sonogashira reakcija, SCC, *Sonogashira cross-coupling* – reakcije unakrsnog povezivanja terminalnih alkina s organskim halogenidima

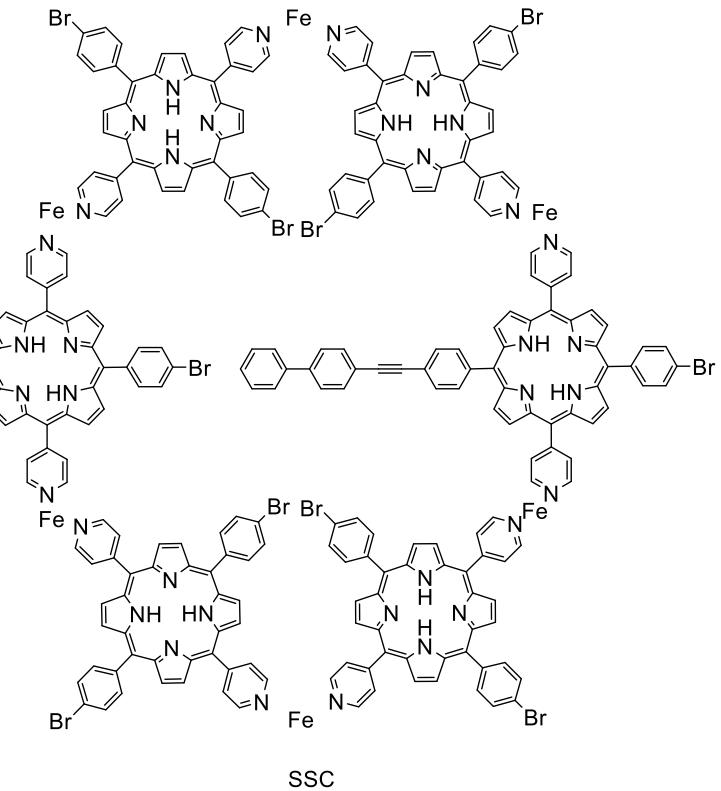
Bez dodatka adatoma – dimeri i trimeri prekursora B1
– SCC produkt <3,4 %



Supstrat – Au(111)

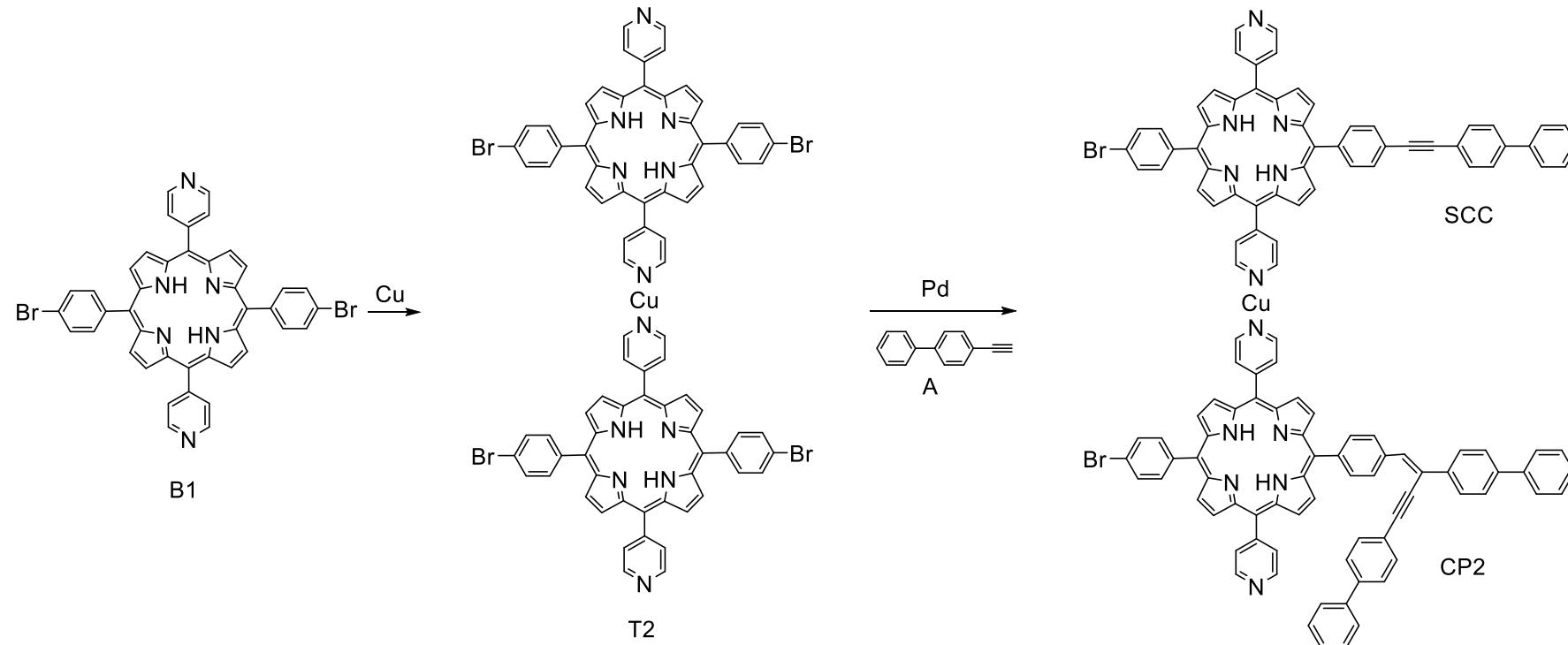
Prekursori – dibromfenilni derivati porfirina (**B1**) i 4-etinilbifenil (**A**)

Fe adatom – organizira B1 prekursor u cikličku strukturu
– SCC produkt oko 20 %

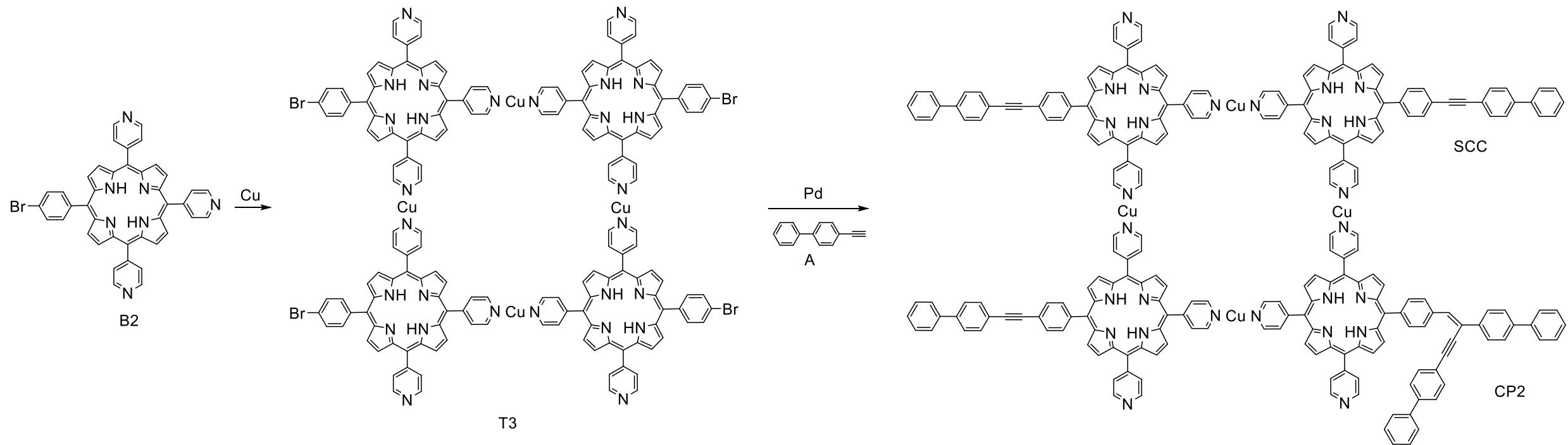


Cu adatom – organizira prekursore u lančane strukture

– uz SCC produkt dolazi i do adicije prekursora A na trostruku vezu SCC produkta
(ukupno iskorištenje 5,2 %)



Br monosupstituirani prekursor + Cu adatom
 – dobiven miješani SCC / adicijski produkt u iskorištenju od 75 %

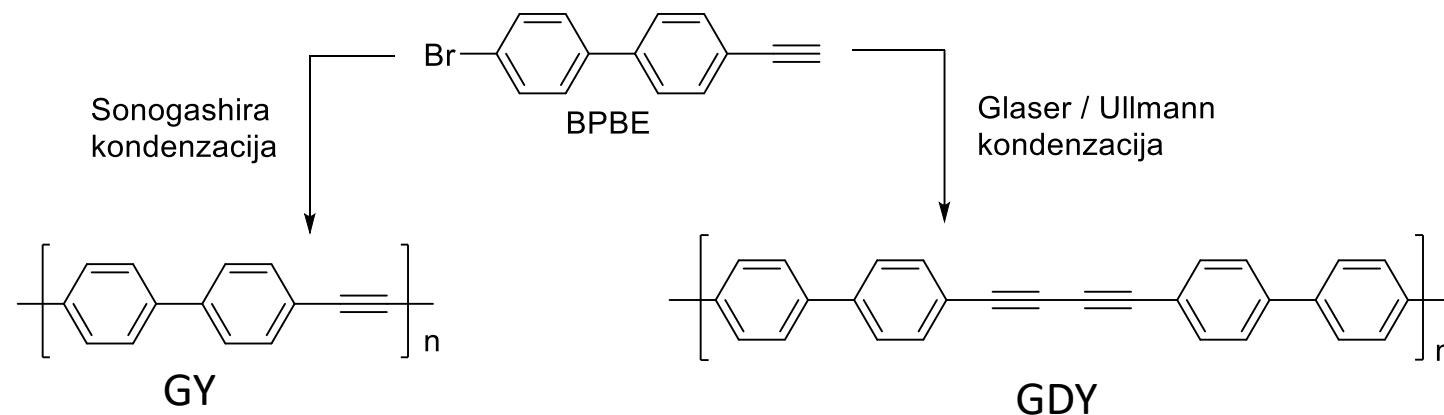


Supstrat – Ag(111)

Prekursor – *para*-bifenilbrometinil (BPBE)

➤ Moguće reakcije:

- Glaserova / Ullmannova → nastajanje grafidina (GDY); energetski preferirani reakcijski put
- Sonogashirina → nastajanje grafina (GY); visoka energetska barijera



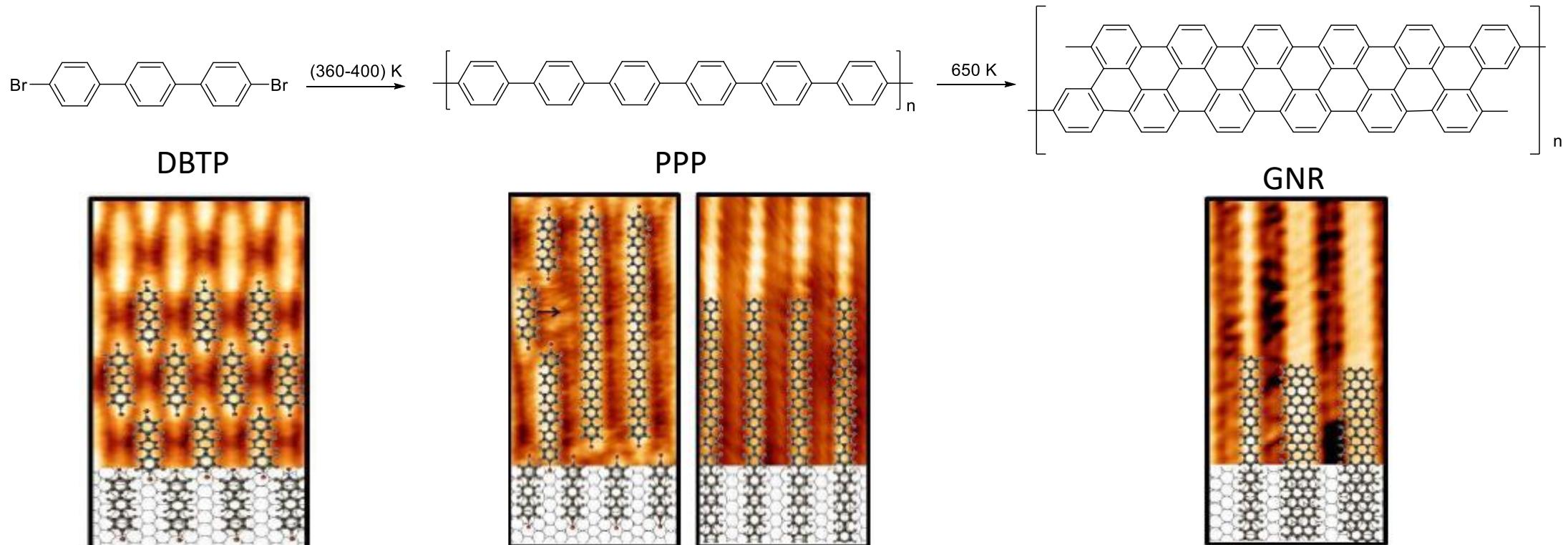
➤ Usmjeravanje reakcije u svrhu dobivanja grafina (GY):

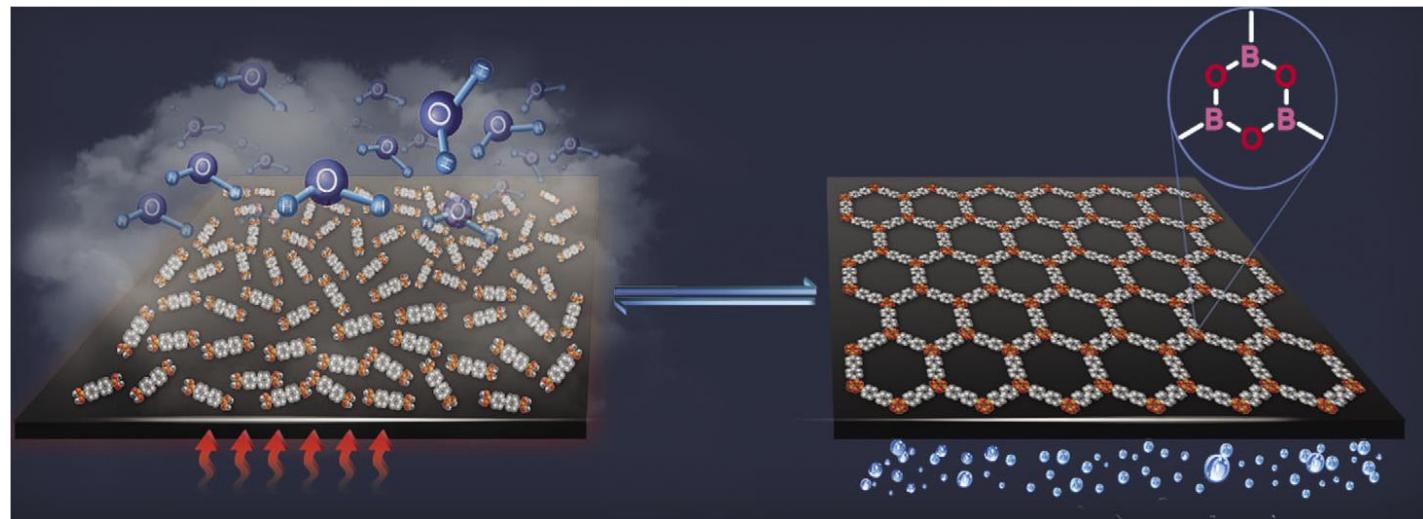
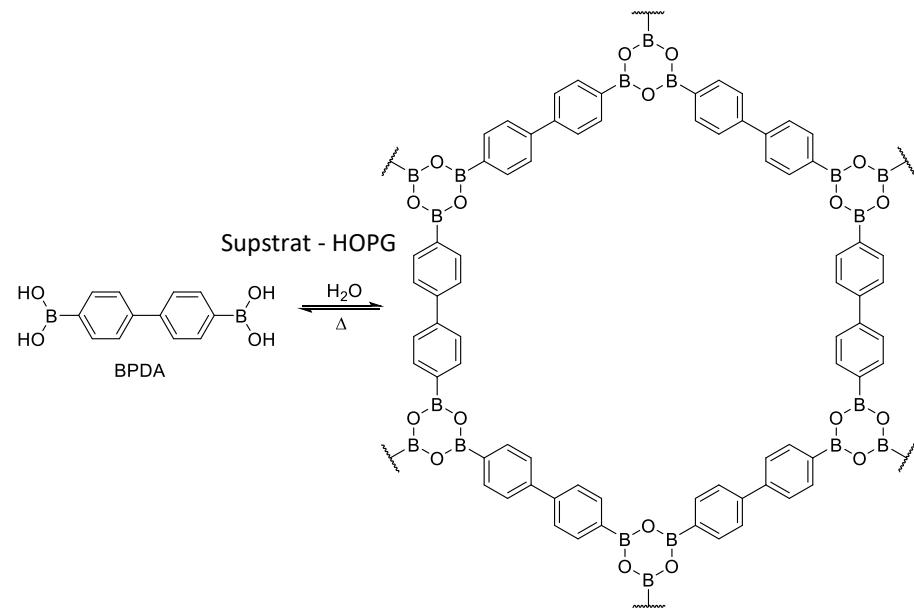
- visoka temperatura supstrata prilikom deponiranja prekursora
- niska površinska pokrivenost supstrata prekursorom
- niska temperatura otparavanja prekursora

Termodinamička kontrola

Supstrat – Au(111)

- deponiranje prekursora na supstrat pri sobnoj temperaturi → uređene strukture
- (360-400) K – Ullmannovo povezivanje → PPP oligomeri
- (450-520) K – rast oligomernih struktura
- 650 K – aktivacija C-H veza (kondenzacija PPP oligomera) → visokouredjene grafenske nanostrukture (GNR)

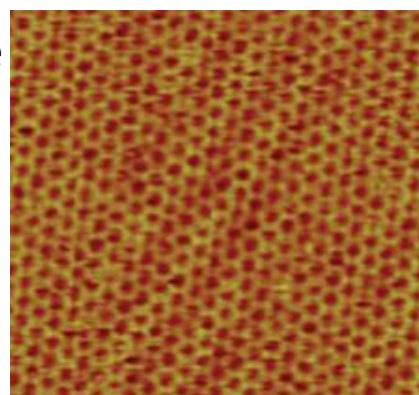




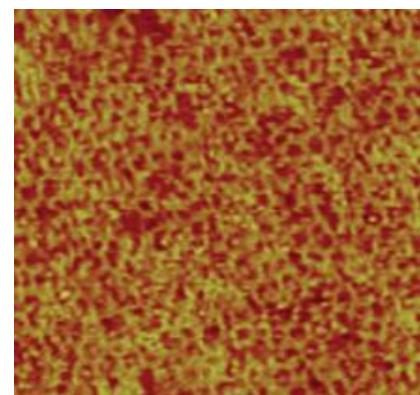
➤ **Reverzibilni reakcijski uvjeti**

- dodatak male količine vode ($\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$)
- zatvoreni reakcijski sustav
- dobivene visokouređene 2D mreže površine $200 \times 200 \text{ nm}^2$ s 98 % pokrivenošću prekursorom
- bez dodatka vode pokrivenost 7 %

STM snimke



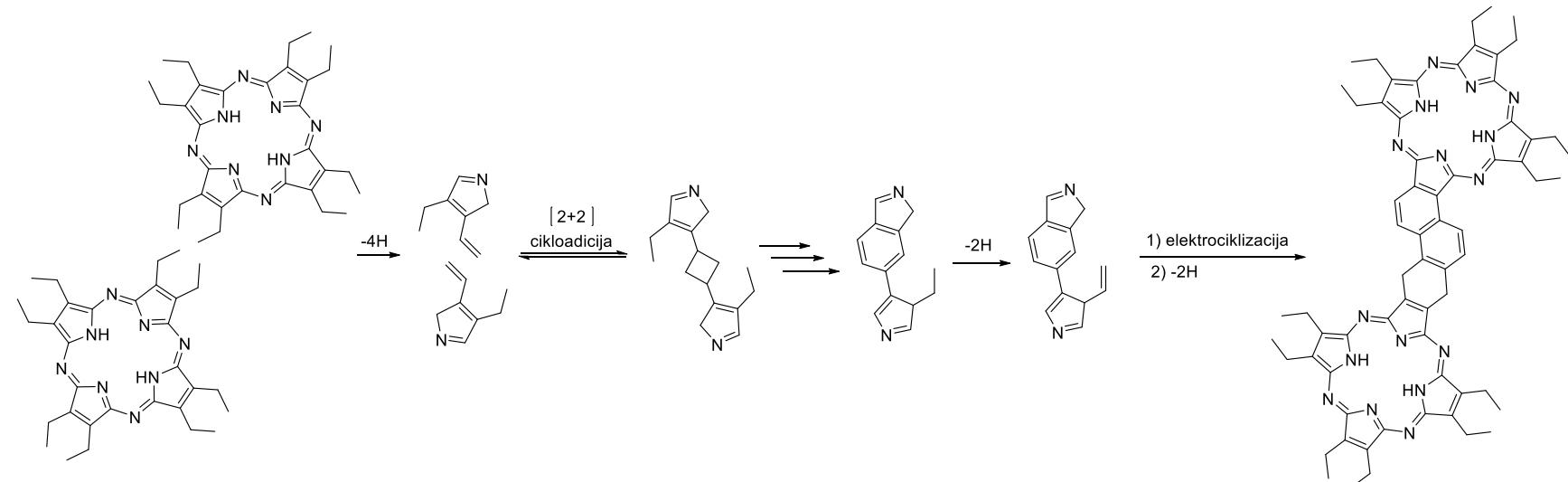
uz dodatak H_2O



bez dodatka H_2O

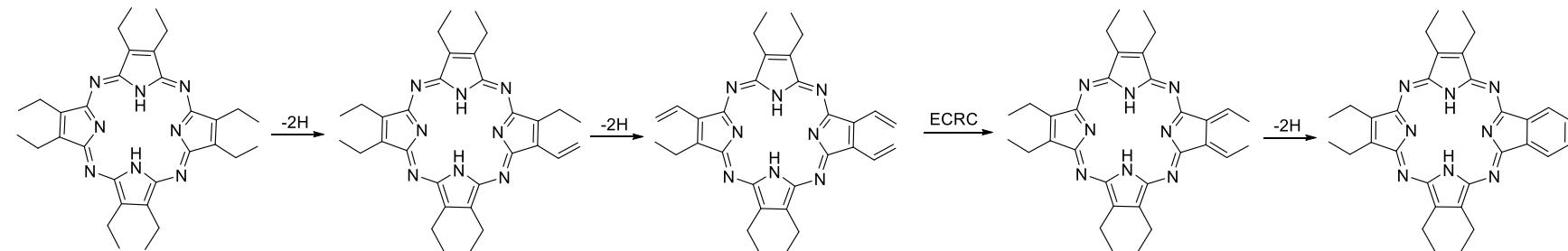
Intramolekulsко vs intermolekulsко povezivanje

- Deponiranje supstrata na sobnoj temperaturi
- supstrati se udružuju u supramolekulske strukture te međusobnoreagiraju uz zatvaranje benzenskog prstena

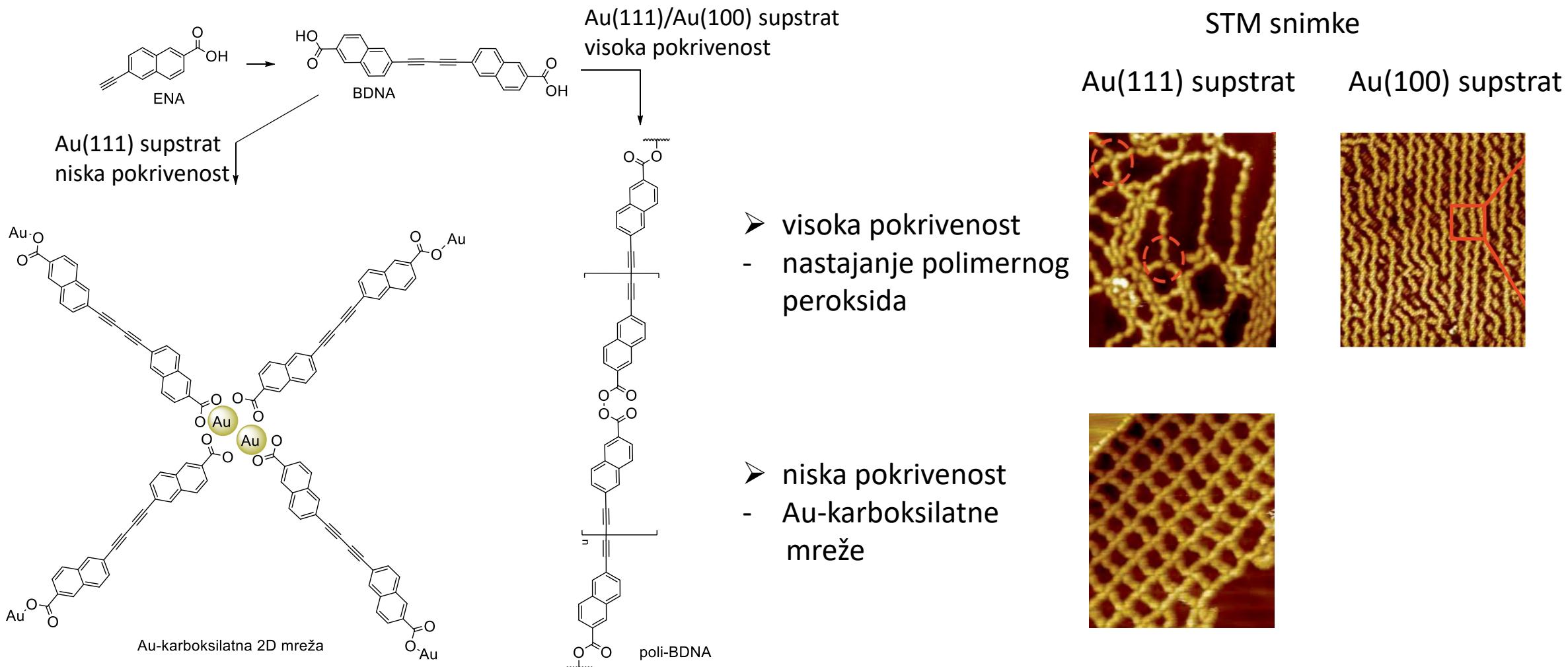


Prekursor - OETAP; Supstrat – Au(111)

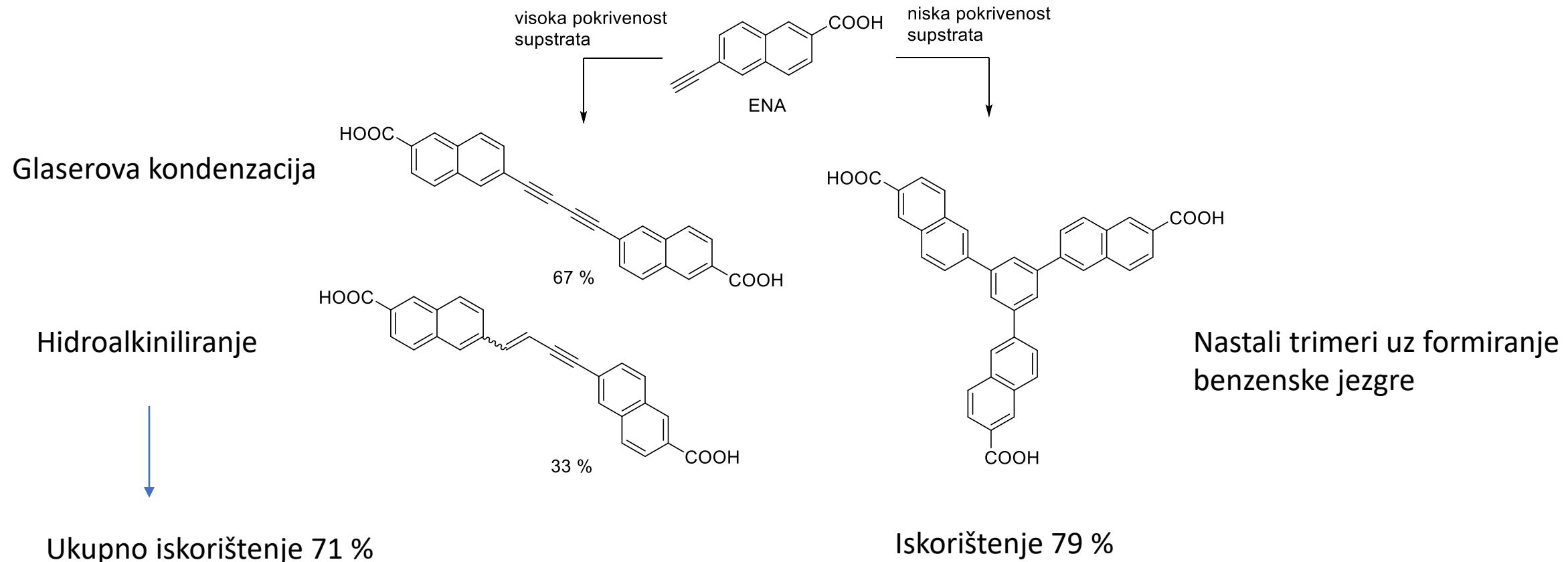
- Deponiranje supstrata na povišenoj temperaturi
- nastaju individualni ftalocijanini koji se potom organiziraju u supramolekulske strukture



Pokrivenost površine supstrata prekursorom (koncentracija)



Ag(111) substrat



Najvažniji čimbenici koji utječu na kontrolu reakcija koje se odvijaju na površinama:

➤ Prekursor

- veličina prekursora – dobivanje različitih veličina pora 2D struktura
- simetrija prekursora – dobivanje različitih motiva
- steričke smetnje – selektivno aktiviranje željenih reakcijskih mesta
- sekvencijsko povezivanje – dobivanje struktura višeg dosega uređenosti

➤ Supstrat

- priroda supstrata – utjecaj na reaktivnost prekursora, selektivnost i reakcijski put
- moduliranje supstrata – omogućavaju pripravu uređenih 1D struktura

- Dodatak adatoma
 - katalizira, odnosno inhibira neke moguće reakcijske puteve

- Kinetička / termička kontrola
 - važna kod kompetitivnih reakcija
 - priprava struktura većeg dosega uređenosti

- Pokrivenost supstrata prekursorom
 - utjecaj na prirodu produkta i doseg uređenosti